

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 3 区分
 【発行日】平成 18 年 7 月 6 日 (2006.7.6)

【公表番号】特表 2005-535778(P2005-535778A)
 【公表日】平成 17 年 11 月 24 日 (2005.11.24)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-046
 【出願番号】特願 2004-533313(P2004-533313)
 【国際特許分類】

C 0 8 F 257/02 (2006.01)

C 0 8 F 8/30 (2006.01)

C 0 8 F 8/36 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 F 257/02

C 0 8 F 8/30

C 0 8 F 8/36

【手続補正書】
 【提出日】平成 18 年 5 月 19 日 (2006.5.19)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

5 ~ 5 0 0 μ m の粒子径を有する単分散のゲル状イオン交換体を製造する方法であり、
 a) 非架橋単分散シードポリマー (0 . 5 ~ 2 0 μ m の粒子径を有する) を、非水性溶媒の存在下でモノエチレン性不飽和化合物のラジカル開始重合により製造し、
 b) 活性化スチレン含有のモノマー混合物をフィードとしてこのシードポリマーに添加し、前記モノマー混合物を、前記シードに浸透膨潤させ、前記混合物を高温で重合させ、上記のモノマー混合物の添加、浸透膨潤、及び重合の段階を、適宜、1 回以上繰り返し、最終添加中の前記モノマー混合物は架橋剤 2 ~ 5 0 重量 % を含有し、
 c) 結果として生じたポリマーを官能化によりイオン交換体に変換することを特徴とする、5 ~ 5 0 0 μ m の粒子径を有する単分散のゲル状イオン交換体を製造する方法。